

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年6月17日(2010.6.17)

【公開番号】特開2008-288619(P2008-288619A)

【公開日】平成20年11月27日(2008.11.27)

【年通号数】公開・登録公報2008-047

【出願番号】特願2008-219416(P2008-219416)

【国際特許分類】

H 01 L 21/027 (2006.01)

G 03 F 7/20 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/30 5 1 5 D

H 01 L 21/30 5 1 6 F

G 03 F 7/20 5 2 1

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月27日(2010.4.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

パターン化された放射ビームを投射する投射系と、

前記投射系の最終要素と基板及び／又は基板テーブルとの間の空間を浸漬液で充填する液体供給システムとを含み、

前記液体供給システムのガスの入口及び／若しくは出口、かつ／或いは前記投射系の前記最終要素以外の部分が、前記浸漬液との間で90°より大きい接触角を有する表面を備えることを特徴とする、リソグラフィ装置。

【請求項2】

前記投射系の前記最終要素以外の表面が、前記液体供給システムよりも上方にある、請求項1に記載のリソグラフィ装置。

【請求項3】

前記投射系の前記最終要素以外の表面が、前記基板に対して実質的に平行である、請求項1又は2に記載のリソグラフィ装置。

【請求項4】

前記投射系の前記最終要素以外の表面が、実質的に環形状である、請求項1乃至3の何れかに記載のリソグラフィ装置。

【請求項5】

前記投射系の前記最終要素以外の表面が、前記浸漬液との間で100°以上の接触角を有する、請求項1乃至4の何れかに記載のリソグラフィ装置。

【請求項6】

投射系の最終要素と基板及び／又は基板テーブルとの間の、液体供給システムによって画定された空間を介して、パターン化された放射ビームを投射することと、

前記空間を浸漬液で充填することと、を含むデバイス製造方法であって、

前記液体供給システムのガスの入口及び／若しくは出口、かつ／或いは前記投射系の前記最終要素以外の部分が、前記浸漬液との間で90°より大きい接触角を有する表面を備える、ことを特徴とする方法。